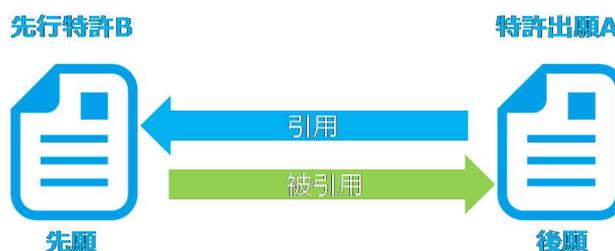


Q

引用・被引用文献情報というデータがあるが、どのように活用すれば良いのだろうか。

## 1. 基礎知識

特許出願 A の審査において、審査官が先行特許 B を引用した場合、先行特許 B を特許出願 A の引用文献といい、特許出願 A を先行特許 B の被引用文献という。



引用・被引用文献の関係性

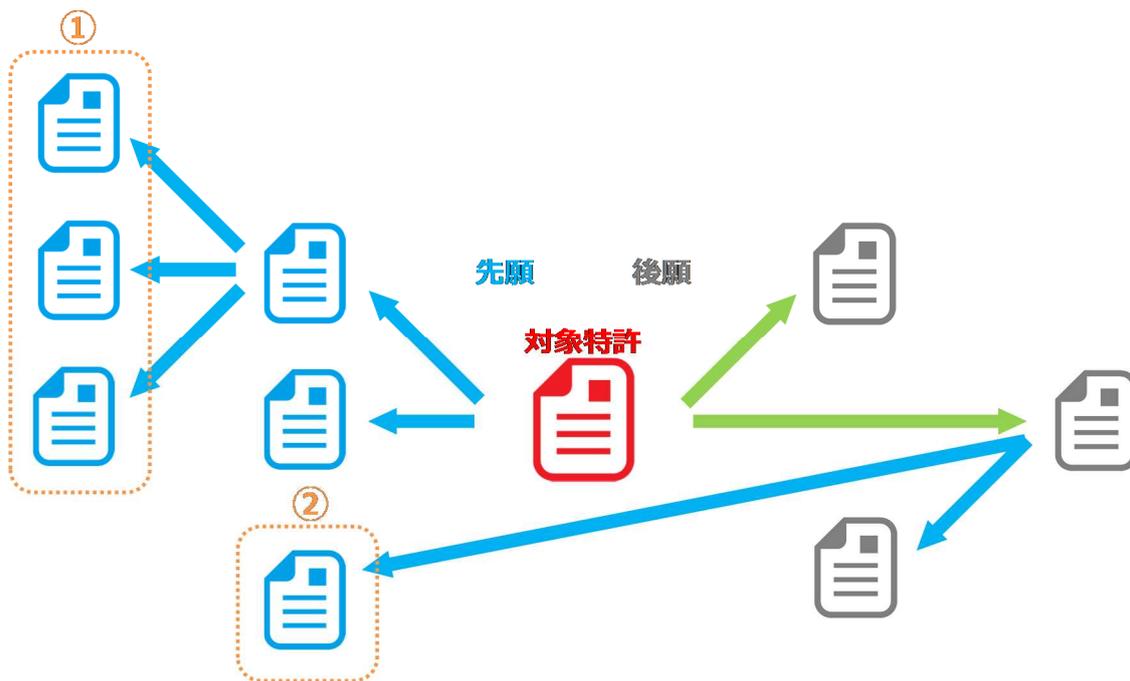
また、ひとつの特許公報に対して引用文献および被引用文献は複数存在することが多く、その数を引用文献数、被引用文献数という。

引用文献に関する情報は、無料で利用できる特許情報プラットフォーム<sup>i</sup> (J-PlatPat) の審査書類情報照会や経過情報照会から確認することができる。一方、被引用文献に関する情報は、J-PlatPat から確認することはできないため、商用データベースを利用する必要がある。

## 2. 活用事例～無効資料調査～

ある特許（対象特許）を無効化するための先行資料を探したいとき、引用・被引用文献情報を活用して調査を行うことができる。引用・被引用の関係にある特許公報同士というのは、類似の内容を開示している可能性が高く、こうした関係性を無効資料調査に活用しようというものである。

対象特許の引用文献はもちろんのこと、引用文献のさらなる引用文献（下図①）や、被引用文献の引用文献（下図②）など、引用・被引用の関係性をたどっていくことで、関連資料を見つけられる可能性がある。



引用・被引用文献情報を無効資料調査に活用

この方法は、特許分類やキーワードを使った検索をする必要がないため、検索に不慣れな場合でも対象特許の特許番号さえ分かれば簡単に行える方法である。商用データベースでは、特許を表示する際、引用・被引用文献へのリンクが同時に表示されるので、引用・被引用の関係性を簡単にたどることができる。

### 3. 活用事例～重要特許の把握～

被引用文献数が多い特許公報というのは、それだけ多くの後願の特許出願に影響を及ぼしているものであり、重要な特許であると考えられる。こうした考え方にに基づき、例えば、自社特許にかかる維持年金削減のため、放棄候補を選択する際の指標として被引用文献数を活用することができる。自社特許 1 件 1 件について被引用文献数を取得し、これを参考情報としてその数が少ないものから順に放棄候補として検討するといったことができる。

商用データベースでは、特許の書誌情報を出力する際の出力項目として被引用文献数を選択することができるため、数百、数千といったまとまった件数であっても短時間で簡単に被引用文献数を取得することができる。

自社特許に被引用文献数を付けて一覧出力

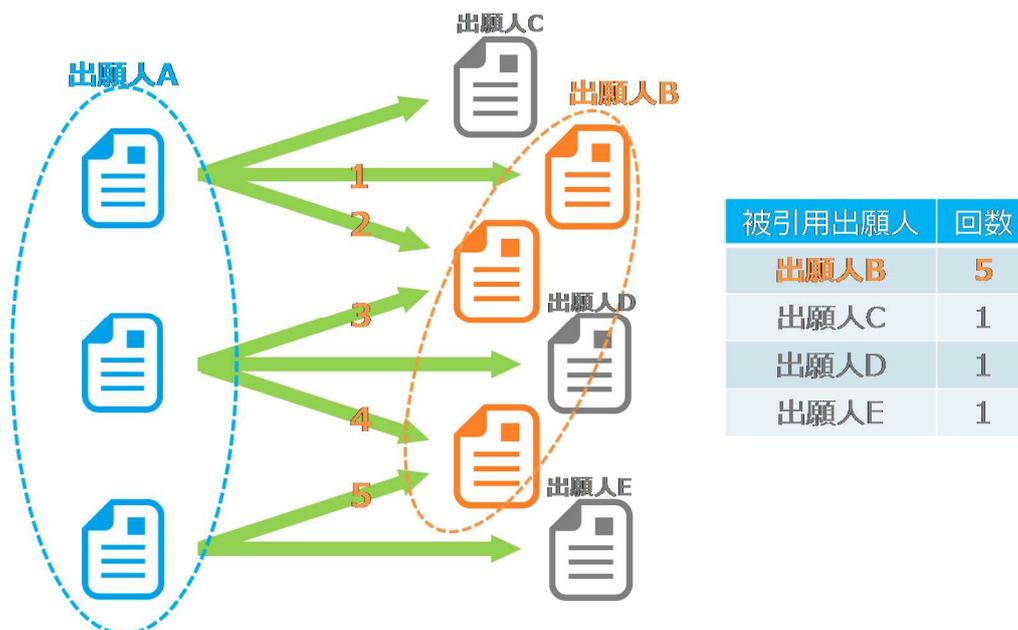
No.	特許番号	被引用文献数
1	特許第XXXXXXXX号	80
2	特許第XXXXXXXX号	45
3	特許第XXXXXXXX号	43
4	特許第XXXXXXXX号	41
5	特許第XXXXXXXX号	32
6	特許第XXXXXXXX号	30
7	特許第XXXXXXXX号	25
⋮	⋮	⋮



被引用文献数を特許評価に活用

#### 4. 活用事例～ライセンス先候補の選定～

自社特許を引用して拒絶された後願特許の出願人の情報から、自社の技術に関心が高いと考えられる企業を把握することができる。出願人 A の特許公報によって複数の特許出願が拒絶されている出願人 B にとって、出願人 A は類似技術で先行する特許権を保有しており、その特許を利用したいと考える可能性がある。すなわち、出願人 A が自社特許のライセンスや売却を考えた場合に、出願人 B を交渉の候補として検討することが考えられる。



被引用文献の出願人情報から交渉候補選定

複数の特許をまとめて特許群としてライセンス検討するような場合であっても、商用データベースでは被引用文献番号を数百、数千といった単位で出力することができ、自社特許群を引用している出願人のランキングを作成することができる。

## 5. 引用・被引用文献情報の留意点

出願公開からの経過時間が長いほど、特許が他者から引用される機会が高まる。そのため、同じ被引用文献数であっても10年前に公開された特許公報と、半年前に公開されたばかりの特許公報とでは単純に比較することができない点に留意すべきである。

### Point

引用・被引用文献情報は、無効資料調査、重要特許の把握、ライセンス先候補の選定といった場面で活用できる。

<sup>i</sup> J-PlatPat：特許情報プラットフォーム（Japan Platform for Patent Information）の略称であり、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）が運営する特許、実用新案、意匠及び商標などの産業財産権関連の無料のデータベースである。